

分析結果報告書

2006年 8月29日

分析No 06886

貴社名 株式会社

工場名 前橋精機プラント 液量 約5000 L (株)アメリロイド日本サービス社

機械名 高周波焼入れ設備 IH-1、2 流量 10 L/min 分析センター

試料名 高周波焼入れ液 フィルタ名 WF2K(デモ機):撤去

銘柄 設置日 20 年 月 日



試験項目	採取月日	① 7 / 31 (9 : 30)	② 8 / 4 (9 : 00)	試験方法
	採取個所		タンク内 7/24液交換実施 7/21デモ機撤去 撤去1週間後	
備考				
汚染度	mg/100ml	61	94	JIS B 9931
粒径分布 個/100ml	5~15 μm	2,056,996 (外)	6,115,092 (外)	JIS B 9930
	15~25 μm	231,040 (外)	749,015 (外)	
	25~50 μm	89,434 (外)	447,173 (外)	
	50~100 μm	53,661 (外)	153,157 (外)	
	100 μm以上	36,892 (外)	108,812 (外)	
油分	mg/l	624.3	8711.7	
pH				JIS Z 8802
動粘度	40°C mm ² /S			JIS K 2283
全酸価	mgKOH/g			JIS K 2501

▼粒径分布 HIAC/ROYCO自動粒子計測器システムNo.8011 [粒径分布の()内数字はNAS等級。]

▼ろ過フィルタ 微粒子画像処理システム計測法

▼ろ過量 0.8 μm 5 μm

▼写真倍率 : 100ml 10ml

×50

所見:

この所見は、一定の方法で採取された試料と正しい試料情報を前提とした参考所見であり、御社の活動を制約するものではありません。

